

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁴ C07D 401/10	(11) 공개번호 특 1988-0001635
	(43) 공개일자 1988년 04월 25일
(21) 출원번호	특 1987-0002961
(22) 출원일자	1987년 03월 30일
(30) 우선권주장	176464 1986년 07월 25일 일본(JP) 181027 1986년 07월 30일 일본(JP) 34161 1987년 02월 17일 일본(JP)
(71) 출원인	오오쓰카 세이야꾸 가부시키 가이샤 오오쓰카 아끼히꼬
(72) 발명자	일본국 도오교도 지요다꾸 간다쓰까사쯔 2쵸메 9 후지이 세쓰로
(74) 대리인	일본국 교오또후 교오또시 나가교오꾸 고꼬마찌도리 산조사가루 에비야쯔 323 이준구, 백락신

심사청구 : 없음

(54) 5-플루오로우라실 유도체, 그의 제조방법 및 용도

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

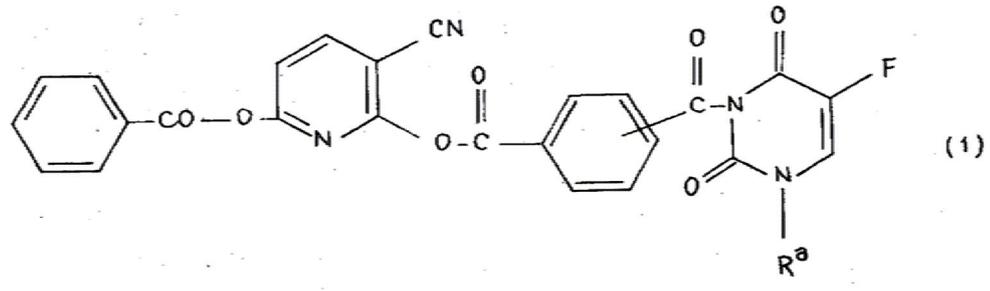
5-플루오로우라실 유도체, 그의 제조방법 및 용도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

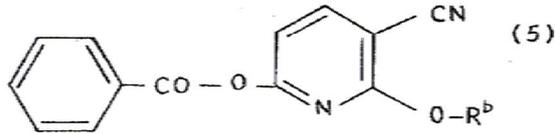
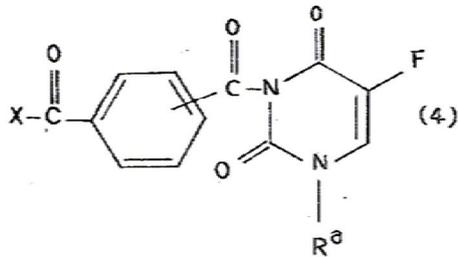
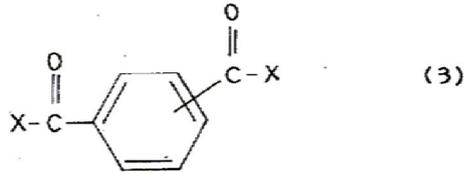
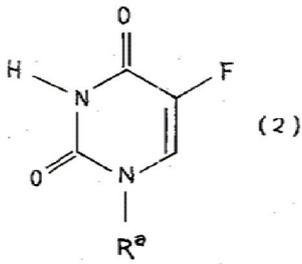
하기 일반식(1)로 나타내는 5-플루오로우라실 유도체의 제조방법으로서;



[상기 식중, R^a는 C₁~C₆ 알콕시메틸기이다.]

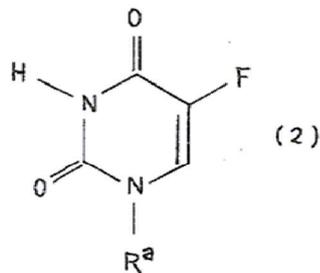
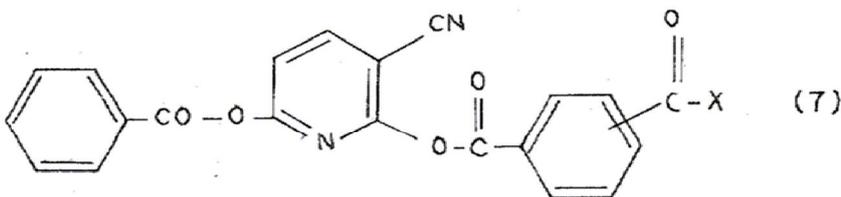
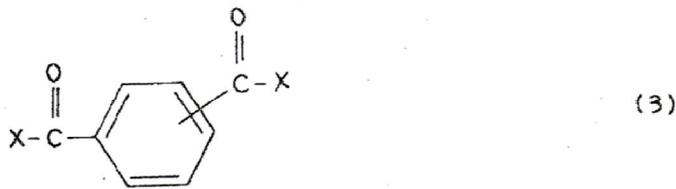
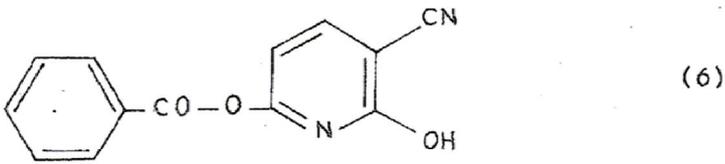
(a) 하기 일반식(2)로 나타내는 화합물을, 산 스케빈저 존재하의 유기용매내에 하기 일반식(3)으로 나타내는 화합물과 반응시켜서 하기 일반식(4)로 나타내는 중간 생성물을 수득하여, 일반식(4)의 중간 생성

물을 유기용매내에서 하기 일반식(5)로 나타내는 화합물과 반응시키거나;



[상기 식들중, R^a는 상기에서 정의한 바와 동일하며, R^b는 수소원자 또는 트리(저급알킬)실릴기이고, X는 할로겐원자이다.] 또는

(b) 하기 일반식(6)으로 나타내는 화합물을, 산 스캐빈저 존재하의 유기용매내에서 하기 일반식(3)으로 나타내는 화합물과 반응시켜서 하기 일반식(7)로 나타내는 중간 생성물을 수득하여, 일반식(7)의 중간 생성물을 산 스캐빈저 존재하의 유기용매내에서 하기 일반식(2)로 나타내는 화합물과 반응시킴 ;



[상기 식들중, R^a 및 X는 상기에서 정의한 바와 동일하다.]을 특징으로 하는 상기 일반식(1)의 5-플루오로우라실 유도체의 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

